

附表三、半導體製造與光電材料及原料製造業應定期檢測及申報之固定污染源

行業別	製程別	公告之固定污染源	條件說明	固定污染源空氣污染物檢測項目及頻率									檢測期間規範
				揮發性有機物	三氯乙烯	氫氟酸	鹽酸	氣體組成	排放流率	檢測頻率級數	檢測頻率	檢測頻率級數調整上限	
半導體製造業	各製造程序	各污染源	<p>一、依照公告「公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」之附表所列相同製程條件說明。</p> <p>二、符合「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」管制對象者。</p>	●	●			●	●	第三級	每年一次	得調整為每二年一次	<p>一、應檢測防制設備處理前後之濃度及排放量。每次檢測至少八小時，三氯乙烯每小時至少檢測三個樣品。</p> <p>二、檢測報告應含所測得濃度之各測值、小時平均值及總平均值。計算防制設備去除率及排放量時，應採用所測得濃度之總平均值。</p>

光電材料及元件製造業	各製造程序	各污染源	一、依照公告「公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源」之附表所列相同製程條件說明。	●				●	●	第二級	每半年一次		一、每次檢測應達四小時。 二、處理效率及排放量應採濃度總平均值計算之。
			二、符合「光電材料及元件製造業空氣污染管制及排放標準」管制對象者。			●	●	●	●	第三級	每年一次		一、每次採樣應達三十分鐘，採樣及測定應達三次以上。 二、檢測報告應含所測得各次濃度之測值及總平均值，處理效率及排放量應採濃度總平均值計算之。